



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M397261U1

(45)公告日：中華民國 100 (2011) 年 02 月 01 日

(21)申請案號：098212178

(22)申請日：中華民國 98 (2009) 年 07 月 06 日

(51)Int. Cl. : A61L9/14 (2006.01)

(71)申請人：王美心(中華民國) WANG, MEI HSIN (TW)

新北市淡水區鄧公路 2 巷 3 號 4 樓

(72)創作人：王美心 WANG, MEI HSIN (TW)；邱璽臣 CHIU, HIS CHEN (TW)；林季蓉 LIN, CHI JUNG (TW)；陳又嘉 CHEN, YO CHIAS (TW)

申請專利範圍項數：8 項 圖式數：8 共 20 頁

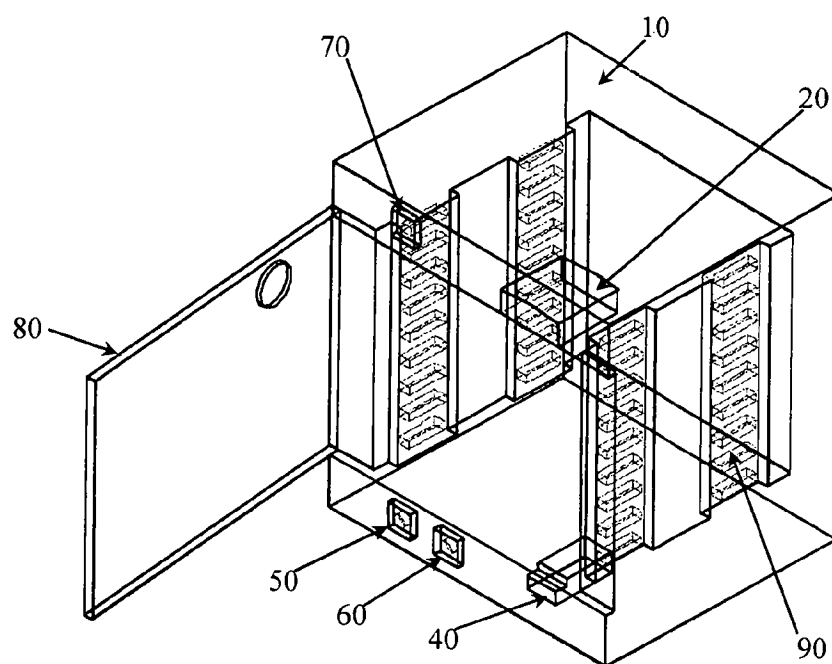
(54)名稱

除臭防霉滅菌設備

ODOR-REMOVING, ANTI-FUNGUS AND DISINFECTION FACILITY

(57)摘要

本創作之目的在於提供設計包含使用穩定性二氧化氯噴霧與固態二氧化氯於密閉空間殺菌、除臭、消毒設備。為一密閉空間設備，包括一穩定性液態二氧化氯噴霧裝置、一固態二氧化氯填充裝置。該密閉空間之開口接觸壁面另貼以氣密貼條加強密閉系統。其中針對穩定性液態二氧化氯噴霧裝置之附近另設置一手動控制噴霧啟動鈕，以便利加強殺菌、除臭、消毒之執行。本裝置之開啟置物方式，可以按壓方式、門把開啟方式與凹槽方式執行。上述殺菌、除臭、消毒設備另可加裝一遠紅外線滅菌裝置。上述殺菌、除臭、消毒設備更可加裝一溼度控制裝置。上述殺菌、除臭、消毒設備更可加裝一溫度控制裝置。上述殺菌、除臭、消毒設備底部更可加裝滾輪或腳架與地面或接觸面隔離。



圖(一)

(10) . . . 本創作使用穩定性二氧化氯噴霧與固態二氧化氯於密閉空間殺菌、除臭、消毒設備

(20) . . . 穩定性液態二氧化氯噴霧裝置

(40) . . . 固態二氧化氯填充裝置

(50) . . . 溼度控制裝置

(60) . . . 遠紅外線滅菌裝置

(70) . . . 溫度控制裝置

(80) . . . 本創作之
開啟裝置

(90) . . . 本創作之
可調式隔版置放裝置

五、新型說明：

【新型所屬之技術領域】

本創作係之技術領域屬於空間除臭、防霉、滅菌等用途之設備，特別是應用穩定二氧化氯與固態二氧化氯於密閉空間殺菌、除臭、消毒之設備。

【先前技術】

穩定性二氧化氯 (Stabilized Chlorine Dioxide)，破壞微生物的葡萄糖氧化酶，使其不能參加氧化還原活動並導致細胞的代謝機能發生障礙。二氧化氯還可與細菌中的部分氨基酸發生氧化還原反應，使氨基酸分解破壞，進而控制蛋白質的合成，最終導致細菌死亡達到殺菌效果。二氧化氯是安全消毒劑且具有強的殺菌能力；同時在殺菌過程不產生有害物質，不影響食品、生活應用消費品的風味和外觀性，不產生致癌物的多用途環保型殺菌消毒劑，對人體及動物沒有危害以及對環境不造成二次污染等特點，在常溫條件下延緩食品的腐敗變質，因二氧化氯能阻止蛋氨酸生成乙烯，破壞已生成的乙烯，延緩果蔬衰老與腐爛。

【新型內容】

本創作之目的在於提供設計包含使用穩定性二氧化氯噴霧與固態二氧化氯於密閉空間殺菌、除臭、消毒。

為達上述之目的，本創作為一密閉空間設備，包括一穩定性液態二氧化氯噴霧裝置、一固態二氧化氯填充裝置。該密閉空間之開口接觸壁面另貼以氣密貼條加強密閉系統。其中針對穩定性液態二氧化氯噴霧裝置之附近另設置一手動控制噴霧啟動鈕，

圖(四)本創作之開啟裝置為把手式之結構示意圖

圖(五)本創作之開啟裝置為按壓式且附有墊腳之結構示意圖

圖(六)本創作之開啟裝置為凹槽式且附有滾輪墊腳之結構示意圖

圖(七)本創作之開啟裝置:包括為按壓式(7A)、凹槽式(7B)、把手式(7C)之結構示意圖

圖(八)本創作之底部可附加滾輪墊腳(8A)或滾輪墊腳(8B)之結構示意圖

【主要元件符號說明】

(10)本創作使用穩定性二氧化氯噴霧與固態二氧化氯於密閉空間殺菌、除臭、消毒設備

(20) 穩定性液態二氧化氯噴霧裝置

(21)穩定性液態二氧化氯噴霧裝置之充填部分

(22)穩定性液態二氧化氯噴霧裝置之噴霧部分

(23) 穩定性液態二氧化氯噴霧裝置之噴霧部分之下方噴霧口

(30)手動啟動穩定性液態二氧化氯噴霧之裝置按鈕

(40)固態二氧化氯填充裝置

(50)溼度控制裝置

(60)遠紅外線滅菌裝置

(70)溫度控制裝置

(80) 本創作之開啟裝置

(81) 本創作之按壓式開啟裝置

(82) 本創作之把手式開啟裝置

(83) 本創作之凹槽式開啟裝置

(90)本創作之可調式隔板置放裝置

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：98212178

※申請日：98.7.6

※IPC 分類：A61L 9/14 (2006.01)

一、新型名稱：(中文/英文)

除臭防霉滅菌設備

Odor-removing, Anti-fungus and Disinfection Facility

二、中文新型摘要：

本創作之目的在於提供設計包含使用穩定性二氧化氯噴霧與固態二氧化氯於密閉空間殺菌、除臭、消毒設備。為一密閉空間設備，包括一穩定性液態二氧化氯噴霧裝置、一固態二氧化氯填充裝置。該密閉空間之開口接觸壁面另貼以氣密貼條加強密閉系統。其中針對穩定性液態二氧化氯噴霧裝置之附近另設置一手動控制噴霧啟動鈕，以便利加強殺菌、除臭、消毒之執行。本裝置之開啟置物方式，可以按壓方式、門把開啟方式與凹槽方式執行。上述殺菌、除臭、消毒設備另可加裝一遠紅外線滅菌裝置。上述殺菌、除臭、消毒設備更可加裝一溼度控制裝置。上述殺菌、除臭、消毒設備更可加裝一溫度控制裝置。上述殺菌、除臭、消毒設備底部更可加裝滾輪或腳架與地面或接觸面隔離。

三、英文新型摘要：

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第（一）圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

(10) 本創作使用穩定性二氧化氯噴霧與固態二氧化氯於密閉空間殺菌、除臭、消毒設備

(20) 穩定性液態二氧化氯噴霧裝置

(40) 固態二氧化氯填充裝置

(50) 溼度控制裝置

(60) 遠紅外線滅菌裝置

(70) 溫度控制裝置

(80) 本創作之開啟裝置

(90) 本創作之可調式隔版置放裝置

以便利加強殺菌、除臭、消毒之執行。本裝置之開啟置物方式，可以按壓方式、門把開啟方式與凹槽方式執行。上述殺菌、除臭、消毒設備另可加裝一遠紅外線滅菌裝置。上述殺菌、除臭、消毒設備更可加裝一溼度控制裝置。上述殺菌、除臭、消毒設備更可加裝一溫度控制裝置。上述殺菌、除臭、消毒設備底部更可加裝滾輪或腳架與地面或接觸面隔離。本創作因使用新型除臭防霉滅菌劑二氧化氯，且可選擇性單一或同時使用固態與液態二氧化氯，便利性更高，且二氧化氯毒性較傳統藥劑低且更經濟有效。

為讓本創作之上述和其他目的、特徵和優點能更明顯易懂，下文特舉較佳實施例，並配合所附圖式，作詳細說明如下。

【實施方式】

本創作的實施流程(一): 製作固態二氧化氯

(A)在混合器中加入矽藻土 1 份、氯化鈣 0.05 份、高嶺土 0.075 份及麵粉 0.05 份，再加入穩定性二氧化氯 0.5 份，充分混合後，密封包裝或壓製成片(或丸)，即製成固體穩定性二氧化氯備用。

(B)在混合器中加入矽藻土 1 份，氯化鈣 0.05 份及麵粉 0.05 份，再加入穩定性二氧化氯 0.5 份，充分混合後，密封包裝或壓製成片(或丸)，即製成固體穩定性二氧化氯除臭粉劑或片(或丸)劑備用。

(C)市售之固態二氧化氯亦可為本設備所使用。

本創作的實施流程(二): 充填除臭防霉滅菌之二氧化氯

(A)將穩定二氧化氯液體充填於本創作如圖(一)至(八)所示之除臭防霉滅菌設備 10 中穩定性液態二氧化氯噴霧裝置之填充口 20。
(B)將固態二氧化氯粉劑或片(或丸)劑充填於本創作如圖(一)至(八)所示除臭防霉滅菌設備 10 中之固態二氧化氯裝置填充口 40。

本創作的實施流程(三): 執行可除臭防霉滅菌之儲物

- (A)開啟本創作如圖(一)至(八)所示之除臭防霉滅菌設備 10。
- (B)啟動噴霧裝置 20 一次，預執行除臭防霉滅菌裝置內密閉空間。
- (C)置入儲存之物品
- (D)再啟動噴霧裝置 20 一次，執行對儲存之物品之除臭防霉滅菌。
- (E)每次開啟裝置 80 後，再啟動噴霧裝置 20 一次，執行對儲存之物品之除臭防霉滅菌。

本創作的實施流程(四)：補充填除臭防霉滅菌之二氧化氯

當固態二氧化氯耗盡、或穩定二氧化氯液體耗盡時繼續補充二氧化氯。如圖(一)至(八)所示之裝置中儲存物品之水氣會啟動二氧化氯之除臭防霉滅菌反應。

雖然本創作已以較佳實施例揭露如上，然其並非用以限定本創作，任何熟習此技藝者，在不脫離本創作之精神和範圍內，當可作些許之更動與潤飾，因此本創作之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。

綜上所述，本創作之構造確實符合預期功效與目的，是以本案能符合專利法所規定之實用性與性之要件，又本創作所述之造與其特徵於本案提出申請前未有相同物品公開使用或見於刊物，本案因而具有新型之新穎性，本創作適合於大面積執行，也適合於小面積的操作，容易變換寬度與長度，且除臭防霉滅菌步驟簡易、環保、設備結構簡單，爰依法提請新型專利，並懇請早日賜准本案專利，實感德便。

【圖式簡單說明】

圖(一)是本創作裝置的結構示意圖。

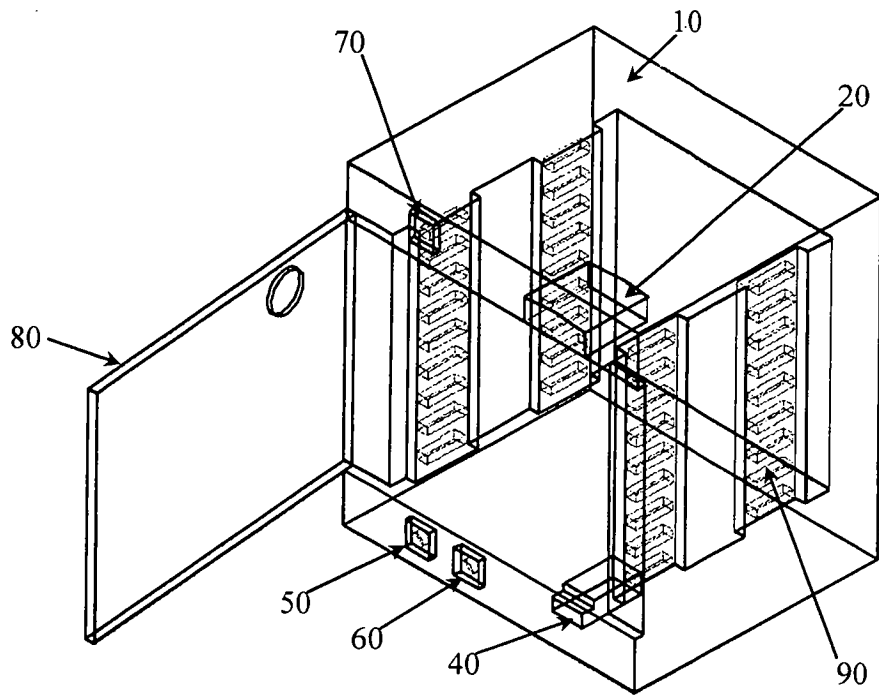
圖(二)是本創作之液態二氧化氯充填與噴霧裝置的結構示意圖

圖(三)是本創作之固態二氧化氯充填的結構示意圖

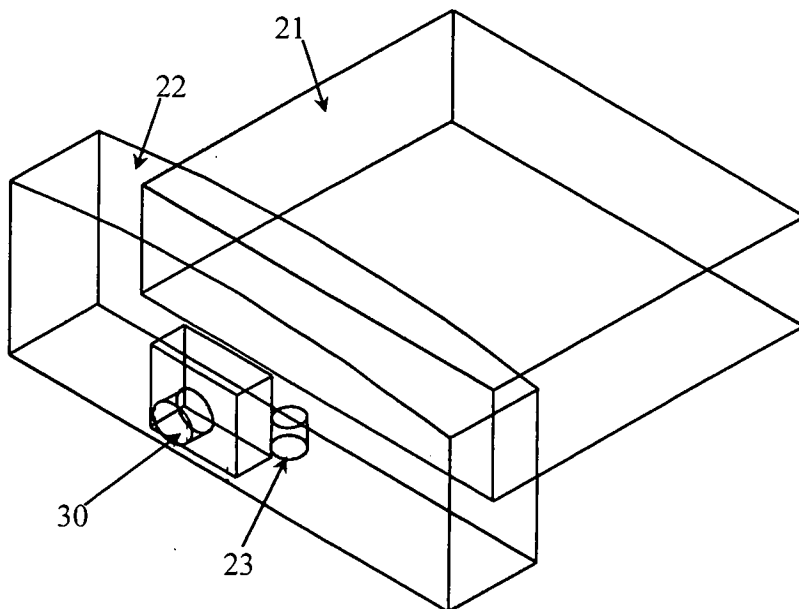
六、申請專利範圍：

1. 一種使用二氧化氯之除臭防霉滅菌設備，包括一密閉空間、一穩定性液態二氧化氯噴霧裝置、一固態二氧化氯填充裝置，其中液態二氧化氯噴霧裝置位於密閉空間的開口面之上部層前方，固態二氧化氯填充裝置位於密閉空間的開口面之下底層前方。
2. 依據申請專利範圍第1項所述之使用二氧化氯之除臭防霉滅菌設備，其中該密閉空間之開口接觸壁面另貼以氣密貼條加強密閉系統。
3. 依據申請專利範圍第1項所述之使用二氧化氯之除臭防霉滅菌設備，其中針對穩定性液態二氧化氯噴霧裝置之附近另設置一手動控制噴霧啟動鈕，以便利加強殺菌、除臭、消毒之執行。
4. 依據申請專利範圍第1項所述之使用二氧化氯之除臭防霉滅菌設備，其中本設備之開啟置物方式，可以按壓方式、門把開啟方式與凹槽方式執行。
5. 依據申請專利範圍第1項所述之使用二氧化氯之除臭防霉滅菌設備，其中本設備另可加裝一遠紅外線滅菌裝置。
6. 依據申請專利範圍第1項所述之使用二氧化氯之除臭防霉滅菌設備，其中本設備更可加裝一溼度控制裝置。
7. 依據申請專利範圍第1項所述之使用二氧化氯之除臭防霉滅菌設備，其中本設備更可加裝一溫度控制裝置。
8. 依據申請專利範圍第1項所述之使用二氧化氯之除臭防霉滅菌設備，其中本設備底部更可加裝滾輪或腳架與地面或接觸面隔離。

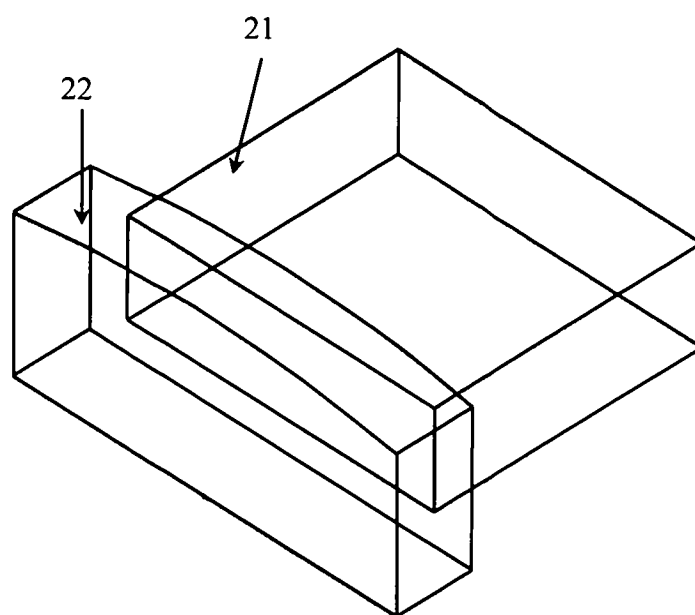
七、圖式：



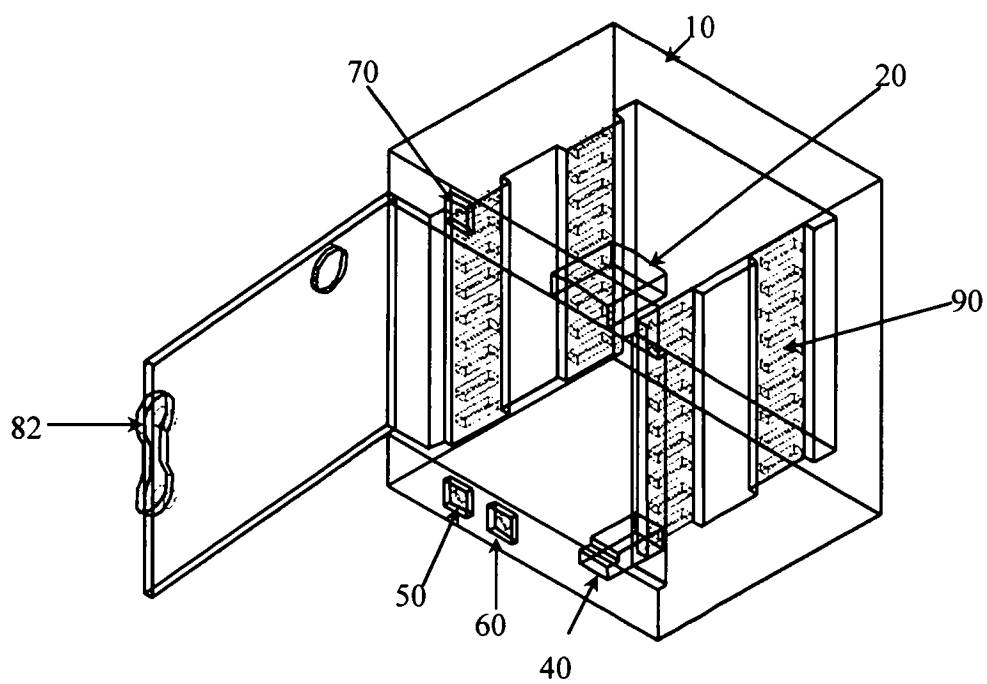
圖(一)



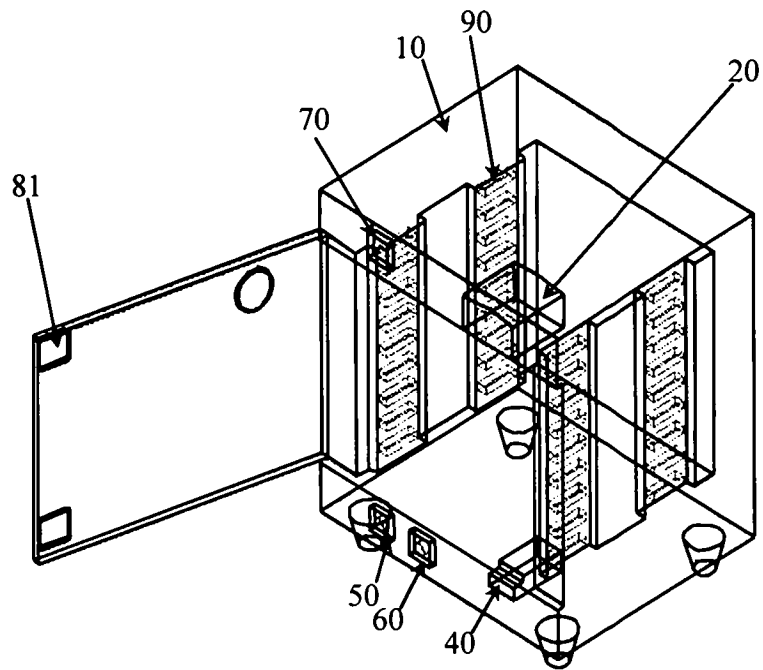
圖(二)



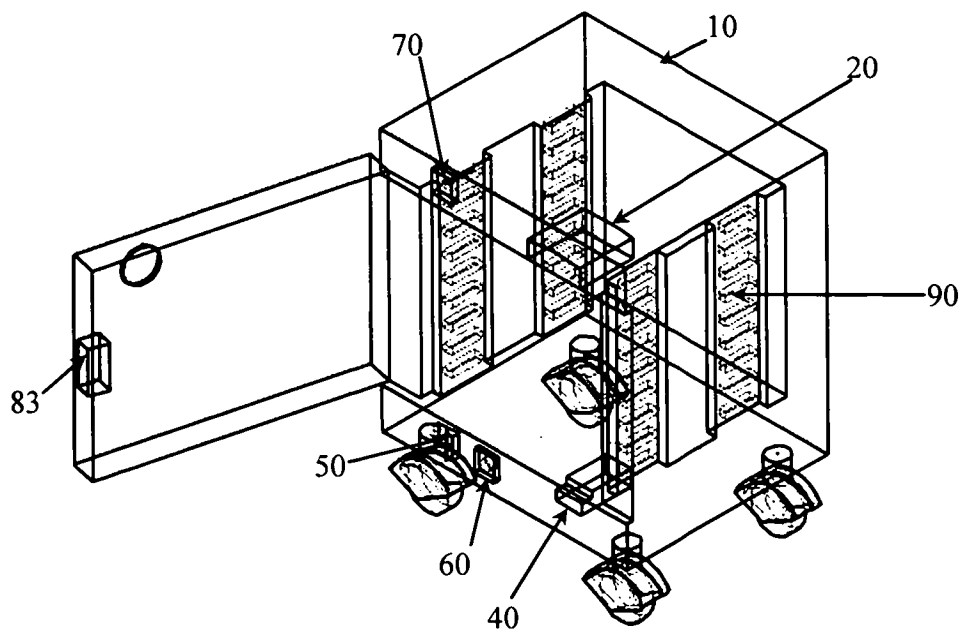
圖(三)



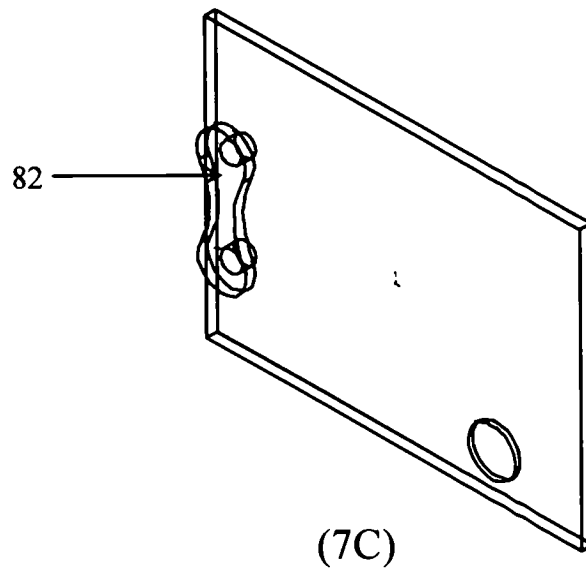
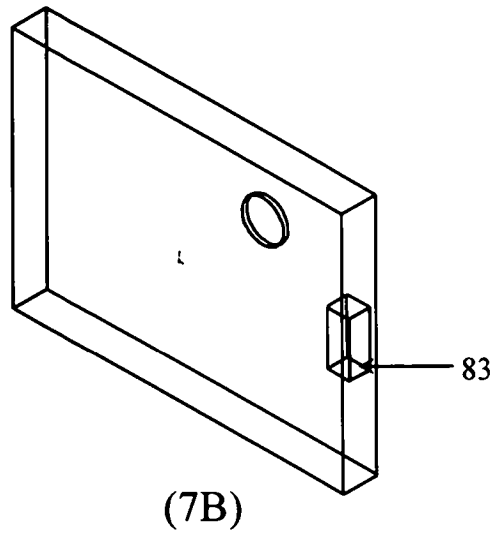
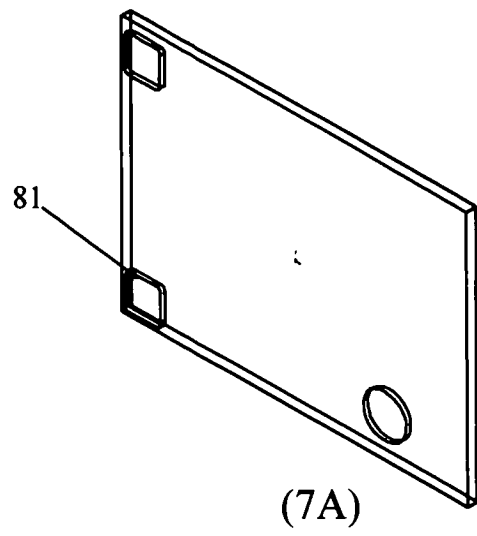
圖(四)



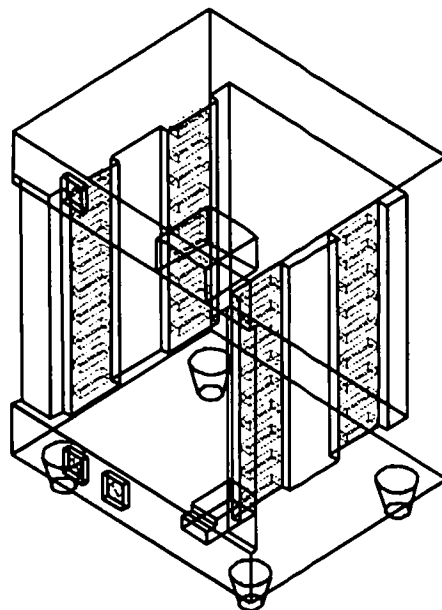
圖(五)



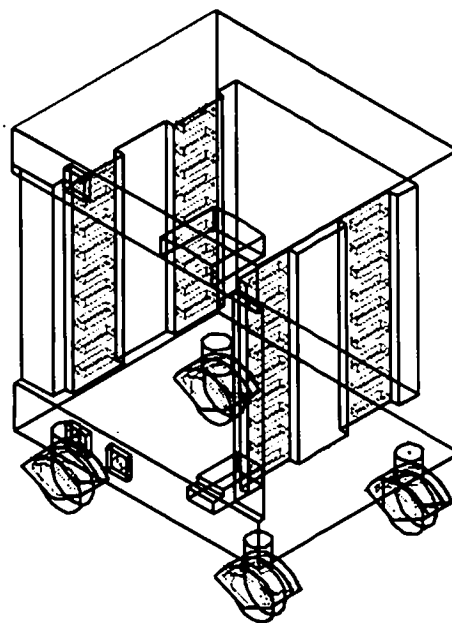
圖(六)



圖(七)



(8A)



(8B)

圖(八)